

期刊信息

篇名	DC-PCVD装置中阴阳极上Si ₃ N ₄ 薄膜沉积模型
语种	中文
撰写或编译	
作者	吴大兴, 周海, 杨川等
第一作者单位	
刊物名称	机械工程材料
页面	1997年8月, Vol.21, No.4
出版日期	1997年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	直流等离子体法沉积氮化硅薄膜形成机理及性能研究